(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



| 1000 B | 1

(43) Date de la publication internationale 4 novembre 2004 (04.11.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/094339 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷:

C04B 35/573

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/000929

- (22) Date de dépôt international : 15 avril 2004 (15.04.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 03/04749 16 avril 2003 (16.04.2003) FR
- (71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US): SICAT [FR/FR]; 14, avenue Hoche, F-75008 Paris (FR). CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCI-ENTIFIQUE [FR/FR]; 3, rue Michel Ange, F-75794 Paris Cedex 16 (FR). UNIVERSITE LOUIS PASTEUR STRASBOURG [FR/FR]; 4, rue Blaise Pascal, F-67000 Strasbourg (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): PHAM-HUU, Cuong [FR/FR]; 3, rue des Eglises, F-67700 Saverne (FR). NGUYEN, Patrick [FR/FR]; 17, rue Molsheim, F-67000 Strasbourg (FR). PHAM, Charlotte [FR/FR]; 3, rue des Eglises, F-67700 Saverne (FR). LEDOUX, Marc, Jacques [FR/FR]; 11, rue d'Ussé, F-67000 Strasbourg (FR).
- (74) Mandataire: SCHMIDT, Martin, Peter; Pechiney, 217, cours Lafayette, F-69451 Lyon Cedex 06 (FR).

- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

 relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de la demande antérieure (règle 4.17.iii)) pour la désignation suivante US

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: USE OF A SILICON CARBIDE-BASED CERAMIC MATERIAL IN AGGRESSIVE ENVIRONMENTS
- (54) Titre: L'UTILISATION D'UN MATERIAU CERAMIQUE A BASE DE CARBURE DE SILICIUM DANS LES MILIEUX AGRESSIFS
- (57) Abstract: The invention relates to the use of an SiC-based composite refractory material as an inner coating for an aluminium smelting furnace or as a coating for a fused salt electrolytic cell. Said material contains inclusions, comprising at least one a-SiC part, in a β-SiC matrix.
- (57) Abrégé: L'invention concerne l'utilisation d'un matériau réfractaire composite base de SiC comme revêtement intérieur de four de fusion d'aluminium ou comme revêtement de cuve d'électrolyse en sel fondu. Ce matériau contient des inclusions, dont au moins une partie en α -SiC, dans une matrice de β -SiC.



2/808

10/553654 JC09 Rec'd PCT/PT0 14 OCT 2005

WO 2004/094339

PCT/FR2004/000929

L'UTILISATION D'UN MATERIAU CERAMIQUE A BASE DE CARBURE DE SILICIUM DANS LES
MILIEUX AGRESSIFS

5

Domaine technique de l'invention

La présente invention concerne les matériaux céramiques pour utilisation dans des milieux agressifs, tels qu'ils se présentent notamment en génie chimique et électrométallurgique, et plus particulièrement les briques réfractaires utilisées dans des fours de fusion ou des cuves d'électrolyse.

Etat de la technique

15

Les métaux liquides et les sels fondus sont parmi les agents chimiques les plus agressifs connus. De nombreux procédés industriels métallurgiques électrométallurgiques faisant intervenir la fusion de métaux et / ou sels, il existe un besoin de matériaux réfractaires qui résistent à un tel environnement. Les équipements pour métaux fondus ou sels fondus, typiquement des fours de fusion ou des cellules d'électrolyse en sel fondu, nécessitent comme revêtement intérieur de grandes quantités de plaques ou briques réfractaires, et le remplacement desdites pièces réfractaires, aussi appelé le regarnissage, immobilise l'équipement pendant une certaine durée. Un matériau qui présente une durée de vie améliorée dans un tel environnement peut donc conduire à au moins trois avantages : 1) une moindre consommation en matériau réfractaire, 2) une moindre contamination du milieu fondu par ledit milieu réfractaire, et 3) une durée d'immobilisation de l'équipement pour maintenance (« down-time ») réduite.

Par ailleurs, ces matériaux doivent résister aux chocs thermiques et mécaniques susceptibles de survenir lors de leur utilisation dans un tel équipement.

Le carbure de silicium de structure a, qui cristallise dans un système hexagonal, lié à d'autres stabilisant inorganiques, est un des matériaux les plus utilisés dans les industries diverses comme céramique de revêtement grâce à ses propriétés mécaniques

et thermiques exceptionnelles, et grâce à sa bonne résistance chimique vis-à-vis des agents corrosifs, essentiellement des alcalins. On exige souvent de briques réfractaires en α-SiC pour utilisation dans des cuves d'électrolyse en sel fondu une porosité ouverte aussi faible que possible, afin de minimiser la pénétration du milieu corrosif à l'intérieur du matériau réfractaire (voir le brevet US 5 560 809 (Saint-Gobain)).

Ce matériau peut être obtenu sous diverses formes macroscopiques telles que brique, cylindre ou monolithe, choisies en fonction de l'application visée. La mise en forme du carbure de silicium fait intervenir en général d'un côté des poudres ou des agrégats à base de carbure de silicium, et de l'autre côté des liants inorganiques. A titre 10 d'exemple, pour fabriquer des briques réfractaires pour cuves d'électrolyse électrométallurgique, on utilise comme liant soit l'oxyde d'aluminium en solution solide dans du Si₃N₄ qui correspond à la formule Si_{3-x}Al_xO_xN_{4-x}, soit l'oxynitrure de silicium Si₂ON₂, soit le nitrure de silicium Si₃N₄. La mise en forme est réalisée ensuite par un procédé permettant de lier d'une manière intime les composés constituants le composite final, tel que le frittage à chaud.

Ce matériau composite présente une combinaison intéressante de propriétés physiques et chimiques, tels qu'une forte résistance mécanique (notamment résistance à la rupture et dureté), une forte résistance thermique (notamment un faible coefficient de dilatation et une forte stabilité thermique), et une forte résistance à l'oxydation, grâce à laquelle le matériau peut être utilisé à l'air libre à des températures dépassant 1000°C.. Ce matériau résiste également aux solutions faiblement alcalines.

15

20

Il souffre aussi de certains inconvénients. Son coût relativement élevé est lié à l'utilisation de températures élevées lors de la synthèse. En ce qui concerne sa résistance en milieu corrosif, on observe pour certains types de liants une fragilisation vis-à-vis de certains agents chimiques fortement corrosifs initialement présents dans le milieu d'utilisation, ou formés dans le milieu d'utilisation. On observe en effet que lors de certaines applications de ce matériau, la présence de produits corrosifs, tels que les acides ou des composés fluorés ou les produits fortement basiques, entraîne une destruction progressive des composés constituants le liant. Cela conduit à terme à la dissolution totale dudit liant, et par conséquence à la destruction de la forme macroscopique du matériau; ainsi la pièce en α-SiC, par exemple une brique réfractaire, se transforme en poudre et/ou agrégats, avec perte de sa forme et de ses caractéristiques mécaniques initiales.

Deux voies ont été explorées dans l'art antérieur pour protéger les composites à base de SiC contre la corrosion : le recouvrement des pièces en céramique à base de SiC avec une couche protectrice plus résistante à la corrosion, et l'utilisation de liants plus résistants à la corrosion.

La première voie est représentée par la demande de brevet FR 2 806 406 A1 (Commissariat à l'Energie Atomique). Elle décrit un procédé de dépôt d'une couche sur la surface de composites à base de SiC, tels que le SiC fritté sans pression, le SiC infiltré Si, le SiC recristallisé poreux, afin de les protéger contre la corrosion et d'augmenter leur résistance chimique lors de l'usage à une température jusqu'à 1600°C. Le procédé mis en œuvre consiste à préparer un mélange en dispersant dans un liant organique liquide les différents constituants de la couche de dépôt, i.e. métal ou siliciure, Si, SiC et/ou du carbone, puis à recouvrir la surface de la pièce à protéger par ledit mélange. L'ensemble est ensuite chauffé à une température comprise entre 1200 et 1850°C. Le recouvrement de la surface de la pièce en SiC à traiter est réalisé par fusion dudit mélange sur la surface de ladite pièce à traiter. Le dépôt ainsi formé a une épaisseur moyenne allant de 1 à 50 µm. La nature et la résistance du dépôt varie en fonction de la nature dudit métal et de la composition de la couche appliquée. Néanmoins, les exemples donnés ne concernent que des compositions de la couche de dépôt et l'observation de ce dernier par microscopie électronique sans qu'il y ait plus d'informations sur la résistance accrue du dit composite vis-à-vis de l'oxydation ou des milieux agressifs qui constituent le but final recherché.

20

25

Un inconvénient spécifique de cette voie est la possible apparition de microfissures entre la couche protectrice et le composite lors de la fabrication ou l'utilisation de pièces ainsi revêtues, due à des différences entre les coefficients d'expansion thermique.

30 La deuxième voie est basée sur l'idée que c'est la nature chimique des liants utilisés dans les matériaux céramiques à base de SiC qui détermine leur résistance à l'attaque par des agents chimiques agressifs tels que les dérivés fluorés ou des acides concentrés

4

ou des alcalins. Selon l'état de la technique, on utilise surtout des liants à base d'oxydes frittables, des nitrures ou des oxynitrures.

Dans les procédés connus, on utilise le carbure de silicium de structure α sous forme de poudre issue directement des synthèses par carboréduction traditionnelle selon la réaction (1):

$$SiO_2 + 3 C \rightarrow \alpha$$
-SiC (ou β -SiC) + 2 CO (1)

La réaction (1) peut être décomposée en deux réactions élémentaires qui sont les suivantes:

10
$$SiO_2 + C \rightarrow SiO + CO$$
 (2)
 $SiO + 2 C \rightarrow SiC + CO$ (3)

Cependant, le SiO s'échappe très rapidement du milieu réactionnel avant que la réaction (3) ne soit complète et de ce fait, entraîne une perte non négligeable du silicium de départ en laissant une grande quantité de carbone non réagit dans le matériau final. Le brevet US 4,368,181 (Hiroshige Suzuki) propose d'améliorer ce procédé en faisant réagir des fines particules de carbone, i.e. diamètre moyen de l'ordre de 60 µm, et de silice, i.e. diamètre moyen de l'ordre de 150 µm, dans un dispositif permettant le recyclage continu afin de diminuer la perte en silicium par perte de SiO et d'augmenter le rendement en SiC. Cependant, le SiC ainsi formé par ce procédé est toujours sous forme de poudre très fine et nécessite une autre étape de préformage avec des liants avant utilisation. Ces liants sont susceptibles d'être corrodés par des solutions fortement acides ou basiques avec comme conséquence la destruction de la structure macroscopique du matériau.

- Par ailleurs, on connaît du brevet EP 511 919 un procédé de fabrication de supports de catalyseur en SiC poreux sous forme de bâtonnets ou granules extrudés à partir d'un mélange de poudre de silicium et de résine organique par polymérisation suivie d'une carburation.
- Les demandes de brevets ou brevets US 5 474 587 (Forschungszentrum Julich GmbH),
 US 2002/011683 A1 (Corning Inc), EP 0 356 800 A (Shinetsu Chemical Co), US 4 455
 385 (General Electric Co), US 4 562 040 (Sumitomo), US 4 514 346

5

(Kernforschungsanlage Jülich), US 6 245 424 (Saint-Gobain Industrial Ceramics) et US 3 205 043 (The Carborundum Company) illustrent également la fabrication et l'utilisation de tels matériaux à base de SiC.

5 Problème posé

La présente invention cherche à surmonter ces inconvénients des procédés selon l'art antérieur. Elle vise à proposer des produits de revêtement intérieur pour fours industriels et cuves d'électrolyse en matériau céramique à base de carbure de silicium, qui présentent une meilleure résistance aux attaques de milieux corrosifs, notamment aux milieux fluorés, aux acides concentrés ou aux milieux alcalins, tout en conservant les propriétés physiques exceptionnelles connues du SiC.

Description des figures

15

La figure 1 montre des images de microscopie électronique à balayage du composite après carburation sous vide dynamique à 1300° C pendant 2 heures. Le mouillage des grains de α -SiC par la matrice β -SiC est visible sur l'image de microscopie présentée sur la Figure 1B.

20

La figure 2 montre des images optiques d'un composite constitué d'agrégats à base de α-SiC avec des liants à base d'Al₂O₃ et de Si₃N₄ avant (A) et après (B) une trempe dans une solution d'HF à 40% volumiques pendant 10 heures. La dissolution des liants par le HF a entraîné la destruction totale de la structure macroscopique du matériau de départ.

Les images (C, D) correspondent à un composite constitué par des agrégats d'α-SiC dans une matrice de β-SiC ayant subi le même traitement que celui des images (A) et (B). On apprécie la forte résistance de ce matériau vis-à-vis des attaques par les solutions fortement corrosives.

Objet de l'invention

La présente invention a comme objet l'utilisation d'un matériau composite à base de SiC comme revêtement intérieur de four de fusion d'aluminium ou comme revêtement intérieur de cuve d'électrolyse en sel fondu, caractérisée en ce que ledit matériau composite contient des inclusions, dont au moins une partie en α-SiC, dans une matrice de β-SiC.

10 Description de l'invention

Le problème est résolu selon la présente invention par le remplacement des liants à base d'oxydes utilisés dans le procédés connus par une matrice constituée par du carbure de silicium de structure β (qui cristallise dans un système cubique à face centrée), et par l'addition d'inclusions

Un tel matériau peut être fabriqué avantageusement par un procédé qui comprend

- (a) la préparation d'un mélange dit « mélange précurseur » comprenant au moins un précurseur du β-SiC, qui peut se présenter notamment sous forme de poudre, grains, ou fibres de taille diverses, avec au moins une résine carbonée, de préférence thermodurcissable,
 - (b) la mise en forme dudit mélange précurseur, notamment en plaques ou briques ;
 - (c) la polymérisation de la résine,
- 25 (d) le traitement thermique à une température entre 1100 et 1500°C pour éliminer les constituants organiques de la résine et former la pièce finale.

On appelle « précurseur du β-SiC » un composé qui forme dans les conditions du traitement thermique (étape (d)) avec les constituants de la résine du β-SiC. Comme précurseur du β-SiC, on préfère le silicium, et plus particulièrement sous forme de poudre. Cette poudre de silicium peut être une poudre du commerce, de granulométrie et de pureté connues. Pour des raisons d'homogénéité, la granulométrie de la poudre de

7

silicium est préférablement comprise entre 0,1 et 20 μ m, de préférence entre 2 et 20 μ m et plus spécialement entre 5 et 20 μ m.

On appelle « résiné carbonée » toute résine contenant des atomes de carbone. Il n'est ni nécessaire ni utile qu'elle contienne des atomes de silicium. Avantageusement, le silicium est apporté uniquement par le précurseur du β-SiC. La résine est avantageusement sélectionnée parmi les résines thermodurcissables contenant du carbone, et notamment parmi les résines phénoliques, acryliques, ou furfuryliques. Une résine de type phénolique est préférée.

10

Dans le mélange précurseur, on ajuste les quantités respectives de résine et de précurseur du β-SiC de façon à transformer le précurseur du β-SiC quantitativement en B-SiC. A cette fin, on calcule la quantité de carbone contenue dans la résine. Une partie du carbone peut également être apportée par ajout direct d'une poudre de carbone dans le mélange de résine carbonée et du précurseur du β-SiC. Cette poudre de carbone peut être une poudre du commerce, par exemple du noir de carbone, de granulométrie et de pureté connues. Pour des raison d'homogénéitié du mélange, une granulométrie inférieure à 50 µm est préférée. Le choix de la composition du mélange résulte d'un compromis entre la viscosité, le coût des matières premières et la porosité finale désirée. Pour assurer la transformation totale du précurseur du β-SiC en β-SiC et permettre ainsi l'obtention d'un matériau final exempt de Si non engagé dans la structure du SiC, un léger excès de carbone est préféré dans le mélange précurseur. Cet excès de carbone peut ensuite être brûlé sous air. Néanmoins, l'excès de carbone ne doit pas être trop élevé afin de ne pas générer une porosité trop important à l'intérieur du matériau après combustion du carbone résiduel induisant ainsi une fragilisation dans la tenue mécanique du composite final. On peut procéder à une deuxième infiltration du composite ainsi synthétisé par le mélange résine/Si, afin de diminuer la porosité au cœur du composite. Cela est utile pour certaines applications qui nécessitent impérativement de minimiser la porosité.

30

Le mélange précurseur peut être mis en forme par tout procédé connu tel que moulage, pressage, extrusion pour obtenir des formes tridimensionnelles telles que des

8

briques, plaques, ou carreaux. La méthode choisie sera adaptée à la viscosité du mélange précurseur, elle-même fonction de la viscosité de la résine et de la composition du mélange précurseur. A titre d'exemple, il est possible d'obtenir par exemple des plaques d'une épaisseur de 1 mm et d'une longueur et largeur de un à plusieurs décimètres. On peut également fabriquer des briques d'une dimension de quelques centimètres à quelques décimètres ou plus. On peut également obtenir des pièces de formes plus complexes, notamment par moulage.

Ledit mélange précurseur est ensuite chauffé sous air à une température comprise entre 100°C et 300°C, préférentiellement comprise entre 150°C et 300°C, plus préférentiellement comprise entre 150°C et 250°C, et encore plus préférentiellement comprise entre 150°C et 210°C. La durée de ce traitement, au cours duquel s'effectuent la polymérisation de la résine et le durcissement de la pièce, est typiquement comprise entre 0,5 heures et 10 heures au palier de température, de préférence entre 1 h et 5 h, et 15 encore plus préférentiellement entre 2 et 3 heures. Lors de cette étape, le matériau dégage des composés organiques volatiles qui créent une porosité résiduelle variable en fonction du taux de carbone présent dans la composition du mélange précurseur et des conditions appliquées lors de la polymérisation. Il est préférable de minimiser cette porosité, surtout pour la fabrication de plaques épaisses (épaisseur typiquement d'au moins 2 mm) et de briques. On obtient ainsi une pièce intermédiaire qui a une certaine tenue mécanique et qui peut de ce fait être manipulée aisément.

20

Ladite pièce intermédiaire ainsi obtenue est soumise à un chauffage sous atmosphère inerte (par exemple hélium or argon) ou sous vide dynamique entre 1100°C et 1500°C pendant une durée allant de 1 à 10 heures, de préférence entre 1 et 5 heures et plus spécialement entre 1 et 3 heures afin de réaliser la carbonisation de la résine puis la réaction de carburation de la matrice. La plage optimale de température est de préférence située entre 1200°C et 1500°C, plus spécialement entre 1250°C et 1450°C. La plage la plus préférée se situe entre 1250 °C et 1400 °C. Le SiC formé à partir du carbone provenant de la résine et du précurseur du β-SiC est du β-SiC.

Lorsque le traitement de carburation est effectué sous gaz inerte, la présence de traces d'oxygène est préférable, surtout lorsque la résine présente un excès de carbone. Dans ce cas, la carburation peut être réalisée par exemple sous une atmosphère contenant des traces d'oxygène. Dans certains cas, l'oxygène provenant des impuretés de l'argon commercial peut suffire. Dans le cas où le produit après carburation présente un taux de carbone résiduel important, celui-ci peut être facilement éliminé par chauffage de la pièces sous air à une température comprise entre 600°C et 900°C, de préférence entre 700°C et 825°C, pendant une durée avantageusement comprise entre 10 minutes et 5 heures.

10

La demanderesse a constaté que la vitesse de polymérisation influe sur la porosité résiduelle dans le matériau final, car une polymérisation trop rapide favorise la formation de bulles de gaz. Or, la présence de bulles de gaz dans la résine peut favoriser la formation de microfissures dans le composite céramique, susceptibles de fragiliser la pièce matériau durant son utilisation. Ce problème peut se poser notamment lors de fabrication de plaques d'une épaisseur d'au moins 1 mm, et de briques. Il est donc utile de réaliser la polymérisation d'une manière assez lente, c'est-à-dire à une température modérée.

Pour la première étape d'infiltration, le procédé préféré fait intervenir une résine carbonée, mais ne nécessite pas l'utilisation d'une résine organique à base de silicium, telles que le polycarboxysilane ou le polymethylsilane, qui sont utilisées dans des procédés connus de fabrication de céramiques incorporant des fibres de SiC; voir EP 1 063 210 A1 (Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Ltd.); ces résines organiques à base de silicium sont relativement chères, et on observe une perte notable de carbone après pyrolyse.

Le procédé décrit ci-dessus permet la fabrication de briques ou plaques réfractaires à base de β -SiC sans inclusions. Lorsque l'on n'ajoute pas d'inclusions (par exemple sous forme de α -SiC), lesdites briques ou plaques réfractaires ont une densité typiquement de l'ordre de 1,5 g/cm³. Cette valeur est trop faible pour certaines utilisation en milieu corrosif, et notamment en milieu fluoré.

10

Dans un mode de réalisation avantageux, on fabrique des plaques d'une épaisseur d'au moins 1 mm, préférentiellement d'au moins 3 mm, et de façon encore plus préférée d'au moins 5 mm. La plus petite section desdites plaques est avantageusement d'au moins 15 mm², et préférentiellement d'au moins 50 mm², avec un rapport de longueur ou largeur sur épaisseur d'au moins 10 et préférentiellement d'au moins 15. Dans un autre mode de réalisation avantageux, on fabrique des briques. La plus petite dimension desdites briques est avantageusement d'au moins 10 mm, et de façon préférée d'au moins 50 mm ou même 100 mm. La plus petite section desdites briques est avantageusement d'au moins 20 cm², préférentiellement d'au moins 75 cm² et encore plus avantageusement d'au moins 150 cm², avec un rapport de longueur ou largeur sur épaisseur d'au moins 3.

Dans les deux cas, il convient de limiter l'excès de carbone et de polymériser lentement pour éviter la formation de grandes bulles susceptibles de fragiliser le matériau lors de sa carburation. Pour l'utilisation du matériau comme revêtement intérieur de four industriel, on prépare le matériau surtout sous forme de plaques ou briques, qui peuvent avoir la forme d'un parallélépipède ou toute autre forme appropriée.

La demanderesse a constaté que pour l'utilisation du matériau dans des fours industriels ou cuves d'électrolyse, il est particulièrement avantageux d'ajouter au mélange précurseur des inclusions dont au moins une partie est constituée de α-SiC. Dans ce cas, l'étape (a) indiquée ci-dessus est remplacée par l'étape (aa):

(aa) la préparation d'un mélange précurseur comprenant des inclusions, dont au moins une partie est constituée de α-SiC, et un précurseur du β-SiC, qui peuvent se présenter sous forme de poudre, de grains, de fibres ou d'inclusions de taille diverses, avec une résine carbonée, de préférence thermodurcissable.

25

Typiquement, on utilise comme inclusions du α-SiC de granulométrie variable allant de 0,1 à plusieurs millimètres. Ce carbure de silicium de forme alpha peut consister en l'un des quelconques carbures de silicium connus à ce jour. Les inclusions sont ajoutées au mélange précurseur en une proportion d'au moins 80% (en poids par rapport à la masse totale du mélange précurseur). Au-dessous de 80%, la densité de la pièce finie est

11

trop faible, sa porosité ouverte est trop élevée, et la pièce verte (pièce formée avant cuisson) est trop molle. Au-dessus de 95%, le liant en β-SiC ne peut plus mouiller complètement les inclusions, ce qui se traduit par une cohésion insuffisante de la pièce finie. Une fraction d'environ 90% d'inclusions convient bien à la plupart des applications en milieu corrosif fluoré.

Une partie du α -SiC peut être remplacée par de l'alumine, de la silice, du TiN, du Si₃N₄ ou d'autres solides inorganiques qui ne se décomposent pas et ne subliment pas aux température de synthèse du composite final. Avantageusement, au moins 50 % et préférentiellement au moins 70% en poids des inclusions sont constitués de α -SiC. Selon les constatations de la demanderesse, pour l'utilisation du matériau comme revêtement intérieur de cuves d'électrolyse d'aluminium ou comme revêtement intérieur d'un four de fusion d'aluminium, la substitution du α -SiC par d'autres inclusions inorganiques n'apporte pas d'avantage technique significatif.

Le solide constituant les inclusions ne se limite pas à une forme macroscopique précise mais peut être utilisé sous différentes formes telles que poudre, grains, fibres. A titre d'exemple, pour améliorer les propriétés mécaniques du composite final, on préfère comme inclusions les fibres à base de α-SiC. Ces fibres peuvent avoir une longueur qui dépasse 100 μm.

20

15

5

Ces inclusions, dont au moins une partie doit être constituée de α -SiC, sont mélangées avec une résine carbonée, de préférence thermodurcissable, contenant une quantité donnée d'un précurseur du β -SiC, de préférence sous forme de poudre de granulométrie allant de 0,1 à plusieurs micromètres.

On obtient ainsi un matériau composite de type α-SiC / β-SiC, comprenant des particules de α-SiC dans une matrice de β-SiC, qui n'a pas besoin de contenir d'autres liants ou additifs.

Une deuxième traitement d'infiltration peut être effectué selon la même procédure décrite : trempage dudit matériau dans un moule contenant la résine, polymérisation puis finalement, traitement de carburation. Ladite résine doit contenir une quantité suffisante du précurseur de β-SiC, par exemple sous forme de poudre de silicium. Ce

12

deuxième traitement permet d'améliorer la résistance mécanique et/ou de supprimer les problèmes inhérents à la présence d'une porosité non désirable une meilleure résistance aux attaques de milieux corrosifs, notamment aux milieux fluorés, aux acides concentrés ou aux milieux alcalins.

5

Le traitement thermique est également simplifié car le composite peut être formé d'une manière indifférente soit sous vide dynamique soit sous atmosphère inerte, i.e. argon, hélium sans qu'il y ait besoin d'un contrôle précis de la pureté de la dite atmosphère, i.e. trace d'oxygène ou de vapeur d'eau présentes comme impuretés dans le gaz utilisé. De plus, la réaction de carburation procède par nucléation à l'intérieur même de la matrice carbone/silicium et de ce fait, est complètement indépendante de la dimension du composite à fabriquer.

Dans une variante préférée du procédé, le carbone et le silicium sont intimement mélangés de la manière suivante: la poudre de silicium (taille de grains moyenne d'environ 10 μm), est mélangée à une résine phénolique qui, après polymérisation, fournit la source de carbone nécessaire à la réaction de formation du β-SiC. Les inclusions sont mélangées ensuite avec la résine puis le tout est coulé dans un moule ayant la forme du composite final désiré. Après polymérisation le solide formé est transféré dans un four permettant de réaliser la carburation finale de la matrice. Durant la montée en température, l'oxygène de structure ou piégé dans la matrice réagit avec le silicium et le carbone pour former du SiO (équation (4)) et du CO (équation (5)) à l'intérieur même de la matrice solide. La carburation procède ensuite par réaction entre SiO et le carbone (6) ou CO avec Si (7) selon les équations suivantes:

25

20

$$2 \operatorname{Si} + \operatorname{O}_2 \to 2 \operatorname{SiO} \tag{4}$$

$$2 \operatorname{C} + \operatorname{O}_2 \to 2 \operatorname{CO} \tag{5}$$

$$\operatorname{SiO} + 2 \operatorname{C} \to \operatorname{SiC} + \operatorname{CO} \tag{6}$$

$$2 \operatorname{CO} + 2 \operatorname{Si} \to 2 \operatorname{SiC} + \operatorname{O}_2 \tag{7}$$

30

13

Le fait que tous les constituants se trouvent intimement mélangés augmente d'une manière considérable le rendement final en SiC avec très peu de perte de silicium dans la phase gaz. La méthode de synthèse permet également de fabriquer du SiC avec une forme macroscopique prédéfinie et non sous forme d'une poudre fine comme c'était le cas avec les résultats de l'art antérieur.

5

10

15

Le procédé décrit ci-dessus permet de réaliser des matériaux ou composites avec une matrice à base de β-SiC pouvant contenir à l'intérieur des inclusions à base de carbure de silicium ou autres matériaux résistants à des utilisations en milieux agressifs, fortement acides ou basiques, et sous des fortes contraintes de températures.

Le matériau composite à base de SiC qui contient dans une matrice de β -SiC des inclusions dont au moins une partie en α -SiC, a de nombreux avantages :

- (i) Il peut être fabriqué par le procédé décrit ci-dessus avec un coût de revient relativement bas par rapport à d'autres procédés, compte tenu des coûts des matières premières (résine constituant la source de carbone, poudre de silicium) et grâce à une économie non négligeable en énergie, le procédé impliquant des températures relativement basses, i.e. ≤ 1400°C. Le nombre limité de matières premières permet également une réduction sensible du coût.
- 20 (ii) La mise en forme du mélange peut être effectuée de manière préférée avant la polymérisation par extrusion, moulage ou pressage. Elle est facile compte tenu de la nature du matériau de départ, à savoir une matrice visqueuse à base de résine, de poudre de silicium et d'inclusions sous forme de poudre et / ou grains de α-SiC dispersé. Ceci permet de préformer le matériau dans des formes relativement complexes.
 25 Alternativement, on peut mettre en forme la pièce par usinage après polymérisation de la résine, de préférence avant le traitement thermique (étape (d)).
 - (iii) La forte affinité chimique et physique entre les différents constituants du composite permet un meilleur mouillage des grains ou inclusions de α -SiC par la matrice à base de β -SiC. Cela est dû à leurs natures chimiques et physiques proches malgré leur différente structure cristallographique, i.e. α -SiC (hexagonal) et β -SiC (cubique). Ces similarités proviennent essentiellement de la spécificité de la liaison chimique Si-C qui régit la plupart des propriétés mécaniques et thermiques ainsi que la

14

forte résistance aux agents corrosifs. Elles permettent également la réalisation de liaisons fortes entre les deux phases (matrice de β -SiC et inclusions) évitant les problèmes de rejet ou de décollement lors de l'utilisation sous contrainte. De plus, les inclusions α -SiC présentent un coefficient de dilatation thermique très proche de celui de la matrice en β -SiC, permettant d'éviter la formation de contraintes résiduelles susceptibles d'apparaître au sein du composite lors du traitement thermique ou lors du refroidissement ; cela évite la formation de fissures qui pourraient être dommageables pour la pièce finie notamment lors de son utilisation dans des fours de fusion d'aluminium ou dans des cuves d'électrolyse en sel fondu, et qui peuvent être difficile à détecter sur la pièce finie.

(iv) La demanderesse a constaté que le matériau composite décrit présente une résistance extrêmement élevée aux milieux corrosifs, notamment aux milieux fluorés, aux acides concentrés ou aux milieux alcalins. Cela est probablement dû à l'absence de liants présentant une plus faible résistance auxdits milieux corrosifs. Les pièces fabriquées en ce matériau ou composite permettent donc une meilleure économie d'utilisation. Plus particulièrement, dans un milieu agressif donné, la durée de vie des pièces en matériau composite est plus importante que celle des pièces à base de SiC utilisant des liants qui ne résistent pas bien à ces milieux agressifs. Cela améliore aussi la sécurité d'emploi des pièces en SiC, notamment leur étanchéité, et ouvre d'autres applications impossibles à envisager avec les matériaux à base de SiC dont les liants ne sont pas chimiquement inertes.

15

25

30

(v) En faisant varier la nature chimique et physique des inclusions, le procédé décrit permet également de préparer d'autres types de composite ne contenant pas seulement que du carbure de silicium mais d'autres matériaux tels que l'alumine, la silice ou tous autres composés, pourvus qu'ils puissent être dispersés dans la résine et qu'ils ne soient pas altérés lors de la synthèse. L'ajout de ces inclusions autres que du α-SiC, dans une proportion variable, permet de modifier les propriétés mécaniques et thermiques du composite final, i.e. amélioration du transfert thermique, de la résistance à l'oxydation ou du colmatage de pores. On peut ainsi adapter le matériau aux exigences précises de l'utilisation prévue.

15

(vi) En faisant varier la proportion des inclusions, et notamment le pourcentage massique de α-SiC, on peut faire varier la résistance thermique et mécanique du matériau, en fonction de l'application visée.

5

La demanderesse a trouvé que ce matériau à base de SiC contenant des inclusions, dont au moins une partie en α-SiC, dans une matrice de β-SiC, peut être utilisé, en particulier sous forme de plaques ou briques réfractaires, comme matériau de revêtement dans diverses applications relevant du génie thermique, du génie chimique et/ou du génie électrométallurgique devant répondre à fortes contraintes mécaniques et thermiques, et / ou en présence de liquides ou gaz corrosifs. Il peut être notamment utilisé dans des éléments constituants des échangeurs thermiques, des brûleurs, des fours, des réacteurs, ou des résistances de chauffage, notamment en milieu oxydant à moyenne ou haute température, ou dans les installations en contact avec des agents chimiques corrosifs. Il peut être utilisé également comme constituant dans certaines pièces utilisées dans les domaines de la technologie aéronautique ou spatiale et de transport terrestre. Il peut également être utilisé comme matériau entrant dans la fabrication des ustensiles utilisés comme support de creuset pour des applications hautes températures telles que la synthèse des barreaux de silicium monocristallin. Le matériau peut être utilisé comme revêtement intérieur de fours, tels que des fours de fusion d'aluminium, et comme garnissage de cuves d'électrolyse en sel fondu, par exemple pour la production d'aluminium par électrolyse à partir d'un mélange d'alumine et de cryolithe. Il peut également être utilisé comme composant d'un bouclier thermique dans un vaisseau spatial.

Une autre utilisation de ces matériaux est celle comme garnissage (revêtement intérieur) de fours d'incinération, tel que des fours d'incinération d'ordures ménagers. Lors de l'incinération, des gaz corrosifs (HF, HCl, Cl₂, NO, NO₂, SO₂, SO₃, etc) peuvent être formés ; ceux-ci peuvent attaquer le revêtement intérieur du four.

La densité du matériau décrit est préférentiellement supérieure à 2,4 g/cm³. Pour les utilisation indiquées, une densité comprise entre 2,45 et 2,75 g/cm³ convient particulièrement bien.

Exemples

Exemple 1: Réalisation de plaques en β-SiC sans inclusions

On mélange dans un malaxeur 1500 g de poudre de silicium (granulométrie centrée sur 7 µm), 560 g noir de carbone (granulométrie centrée sur 20 nm) et 1000 g de résine phénolique.

La pâte ainsi obtenue est ensuite comprimée entre deux surfaces planes pour obtenir une plaque d'épaisseur de 3 mm. Cette plaque est durcie par chauffage à 200 °C pendant 3 heures. Lors de cette étape, on observe une perte de poids correspondant à environ 10 % du poids initial de mélange. La pièce obtenue est facilement manipulable et présente un aspect de surface lisse.

Ladite pièce est ensuite soumise à un chauffage progressif sous balayage d'argon à pression atmosphérique jusqu'à 1360°C, puis elle est maintenue pendant une heure à cette température. On laisse enfin la pièce refroidir jusqu'à la température ambiante.

Lors de cette étape, on observe une perte de poids correspondant à environ 13,5 % de la pièce durcie. L'aspect du matériau est noir car il contient encore environ 7 % de carbone libre. Celui-ci est ensuite éliminé par chauffage sous air à 700°C pendant 3 h. La plaque présente alors une couleur grise caractéristique du β-SiC pur. La densité de cette plaque était de 1,2 g/cm³. Elle ne montrait pas de fissures.

Par un procédé très similaire, on a fabriqué des briques réfractaires en β-SiC avec une plus petite dimension supérieure ou égale à 15 cm, sans fissures.

Exemple 2 : Réalisation de plaques en β -SiC avec inclusions en α -SiC (composite α -SiC) / β -SiC)

25

10

Variante (a):

4,5 g de poudre de silicium (diamètre moyen des particules : environ 7 μ m) sont mélangés avec 5,5 g d'une résine phénolique constituant la source de carbone nécessaire à la carburation pour former du β -SiC destiné à jouer le rôle de liant dans le composite final. On ajoute à ce mélange comme source d'inclusions 7 g de α -SiC sous forme de poudre. Le mélange a été mis en forme par moulage.

17

L'ensemble est polymérisé sous air à 150°C pendant 2 h. La perte de masse au cours de cette polymérisation était de 2 grammes. Le solide ainsi obtenu est soumis à un traitement thermique sous vide dynamique à 1300°C avec une pente de montée en température de 5 °C min⁻¹. Lors de la montée en température, la résine polymérisée se carbonise et conduit, à haute température, à un squelette carboné en contact intime avec les grains de silicium, ce qui facilite la synthèse du SiC. Le composite est maintenu à cette température pendant 2 h afin de transformer le mélange de carbone provenant de la résine carbonisée et le silicium en β-SiC. Le composite obtenu est refroidi ensuite avec l'inertie thermique naturelle du four jusqu'à la température ambiante. La perte de masse au cours de cette étape de traitement thermique était de 1 gramme.

Le produit ainsi obtenu est composé d'un mélange de 50% de α -SiC et 50% de β -SiC dans lequel les agrégats de α -SiC sont dispersés de manière homogène dans une matrice à base de β -SiC. Il présente des propriétés physico-chimiques proches ou similaires de celles des composites à base d'agrégats de α -SiC dispersés dans une matrice d'alumine et de Si₃N₄. Les images obtenues par microscopie électronique à balayage du composite après polymérisation et après carburation sont présentées sur la Figure 1. L'image à basse résolution (fig. 1A) montre clairement une dispersion homogène des grains de α -SiC à travers la matrice constituée de β -SiC généré par la réaction à 1300°C entre le carbone de la résine et le silicium.

On observe également la présence d'une porosité résiduelle dans le composite final. Cette porosité résiduelle a probablement pour origine des contractions ayant lieu au cœur de la résine lors de l'étape de polymérisation. Cette porosité résiduelle peut être éliminée en ajustant la pente de chauffe lors de l'étape de polymérisation ou en utilisant une résine différente. Le mouillage entre les deux phases peut être mieux visualisé par l'image de microscopie à plus fort agrandissement présentée sur la Figure 1B. Ce mouillage est expliqué par les propriétés physico-chimiques très proches des deux matériaux qui inhibent les problèmes de rejets lors du traitement thermique comme c'était le cas avec d'autres liants n'ayant pas le même coefficient de dilatation thermique que le carbure de silicium à protéger.

20

30

Cette manière de préparer les composites permet de faire varier dans une large gamme le pourcentage massique d'α-SiC de départ, afin d'adapter les propriétés du composite, telles que sa résistance mécanique et sa porosité, aux applications visées.

18

Variante (b):

15

20

25

30

Dans une autre variante, on réalise un mélange de 4,5 g de poudre de silicium, 5,5 g de résine phénolique et 73 g de grains de α-SiC. Le Mélange est mis en forme par pressage de manière à ce que la résine et la poudre de silicium viennent combler l'essentiel du volume libre entre les grains de α-SiC.

On procède ensuite de manière identique à l'exemple 2(a).

Le produit obtenu est alors constitué d'un mélange de 91% de α-SiC liés par 9% de β-SiC et présente une densité de 2,5 g/cm³ avec une porosité ouverte inférieure à 20%.

10 Exemple 3: Utilisation des plaques en composite β-SiC / α-SiC en milieu corrosif

Cet exemple permet de mieux apprécier la résistance extrême du matériau composite à base de β-SiC avec inclusions (voir exemple 2) par rapport à un composite à base de α-SiC avec liants à base d'oxydes et / ou nitrures. On a utilisé à cette fin comme milieu corrosif une solution de HF à 40 % volumiques. Il est connu que les vapeurs ou liquides contenant de l'acide fluorhydrique sont extrêmement corrosifs pour les liants à base d'oxydes céramiques, causant de sévères problèmes de destruction de la matrice. Les résultats sont présentés dans la Figure 2.

Le composite α-SiC / liants à base d'oxydes et / ou nitrures (Figure 2A) est complètement détruit après le traitement dans la solution d'HF entraînant la destruction complète de la matrice et seule de la poudre de α-SiC de départ est récupérée (Figure 2B). Le composite α-SiC / β-SiC préparé selon l'exemple 2 (variante (a)) demeure stable, et aucune modification apparente n'a été détectée après le traitement dans l'HF (Figures 2C et D). Cela illustre l'inertie chimique de la matrice à base de β-SiC vis-à-vis de la solution de HF.

Par des essais analogues, la demanderesse a constaté que le composite à base de β -SiC avec inclusions résiste également à des traitements en milieux basiques tels que la soude concentrée à chaud. Le composite à base de α -SiC / liants à base d'oxydes et / ou nitrures est détruit après un traitement similaire, car la soude concentrée dissout les liants.

On a répété cet essai avec le matériau issu de la variante (b) de l'exemple 2. La résistance au HF était excellente.

REVENDICATIONS

- Utilisation d'un matériau composite à base de SiC comme revêtement intérieur de four de fusion d'aluminium ou comme revêtement intérieur de cuve d'électrolyse en sel fondu ou comme revêtement intérieur d'un four d'incinération, caractérisée en ce que ledit matériau composite a été préparé à partir d'un mélange dit « mélange précurseur » comprenant au moins un précurseur du β-SiC et au moins une résine carbonée, et en ce que ledit matériau composite contient des inclusions, dont au moins une partie en α-SiC, dans une matrice de β-SiC.
- Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle la fraction pondérale desdites inclusions est comprise entre 80% et 95% par rapport à la masse totale du mélange précurseur.
 - 3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle une partie desdites inclusions sont de l'alumine, de la silice, du TiN, du Si₃N₄ ou un mélange de ces composés.

20

- 4. Utilisation selon une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle au moins 50% en poids desdites inclusions, et préférentiellement au moins 70% en poids desdites inclusion, sont de l'α-SiC.
- 25 5. Utilisation selon une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle ledit matériau présente une densité d'au moins 2,4 g/cm³, et préférentiellement une densité comprise entre 2,45 et 2,75 g/cm³.
- 6. Utilisation selon une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle ledit matériau est utilisé sous forme de brique ou plaques.

20

7. Utilisation selon une quelconque des revendications 1 à 6 comme garnissage de cuve d'électrolyse pour la production d'aluminium à partir d'un mélange d'alumine et de cryolithe.

PCT/FR2004/000929

1/2

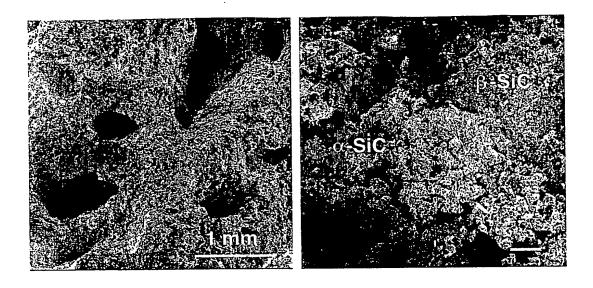


Figure 1 (a) Figure 1 (b)

WO 2004/094339

PCT/FR2004/000929

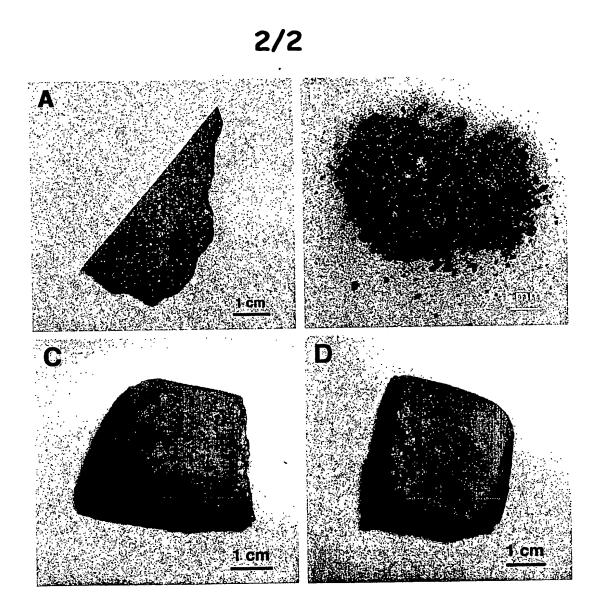


Figure 2



A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C04B35/573		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification CO4B	on symbols)	
110 /			
Desumental		and decrees the second to the grade	- <u> </u>
Documenta	lon searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields se	earched
Electronic d	ata base consulted during the International search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)
	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPE	•	,
2.0 1.1	oci nar, with bubb, I Ao, Inci Eo, Comit	INDEX, CHEN ADD Data	
0.0001111			•
Category °	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.
Α	US 5 560 809 A (CORTELLINI EDMUND) Δ)	1-7
	1 October 1996 (1996-10-01)	,	• ,
	. claim 1	·	
Α	US 5 474 587 A (DIAS FRANCISCO J	FT AL)	1
	12 December 1995 (1995-12-12)	21 7(2)	•
	examples		
Α	US 2002/011683 A1 (GADKAREE KISHO	OR P ET	1
	AL) 31 January 2002 (2002-01-31)	,	.
	claim 12; figure 1; examples		
Α	EP 0 356 800 A (SHINETSU CHEMICAL	(0)	1
^	7 March 1990 (1990-03-07)	1 (0)	1
	examples		
		-/	
	-	-/	
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in	n annex.
° Special ca	tegorles of cited documents:	*T* later document published after the inte	rnotional filling data
A docume	nt defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with clied to understand the principle or the	the application but
"E" earlier o	ered to be of particular relevance locument but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the c	, , ,
filing d	nt which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to
citation	s cited to establish the publication date of another i or other special reason (as specified)	 Y* document of particular relevance; the cannot be considered to involve an inv 	laimed invention
O docume other n	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans	document is combined with one or mo ments, such combination being obvious	re other such docu-
P docume later th	nt published prior to the international filling date but an the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same patent t	•
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	
-	Santanban 2004	00/00/005	
/	September 2004	22/09/2004	
Name and n	nalling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	European Patent onice, P.B. 5618 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Munro, B	

International Application No

0.40	PAGE A POCUMENTS CONCIDEDED TO BE DELEVANT	Fe1/FR2004/000929
Category *	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Oracles of describing from an action, while a property of the contract of the	
A	US 4 455 385 A (PROCHAZKA SVANTE) 19 June 1984 (1984-06-19) column 2, line 25 - line 29; figure 2; examples 3,10	1 .
A	US 4 562 040 A (YAMADA KOICHI ET AL) 31 December 1985 (1985-12-31) examples	1
A	US 5 196 389 A (DUBOTS DOMINIQUE) 23 March 1993 (1993-03-23) column 3, line 21 - column 4, line 16; example 3	1
A	US 4 514 346 A (DIAS FRANCISCO J ET AL) 30 April 1985 (1985-04-30) example 1	1
A	US 6 245 424 B1 (LAU SAI-KWING ET AL) 12 June 2001 (2001-06-12) column 2, line 31 - line 48	1
A	US 3 205 043 A (TAYLOR KENNETH M) 7 September 1965 (1965-09-07) figure 1; examples	1
A	DATABASE COMPENDEX 'Online! ENGINEERING INFORMATION, INC., NEW YORK, NY, US; HUANG QINGWEI ET AL: "Microstructure of reaction-bonded silicon carbide" XP002264185 Database accession no. E2000455311603 abstract & HSI AN CHIAO TUNG TA HSUEH;HSI-AN CHIAO TUNG TA HSUEH/JOURNAL OF XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY FEB 2000, vol. 34, no. 2, February 2000 (2000-02), pages 89-91, 99,	

Information on patent family members

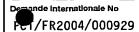
International Application No FCI/FR2004/000929

					7047 000323
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5560809	Α	01-10-1996	AT AU	178105 T 698926 B2	15-04-1999 12-11-1998
			AU	5874096 A	11-12-1996
			BR	9608828 A	15-06-1999
			CA	2219890 A1	28-11-1996
			CN	1185815 A ,B	24-06-1998
			DE	69601870 D1	29-04-1999
			DE	69601870 T2	26-08-1999
			ĒΡ	0828866 A1	18-03-1998
			NO	975404 A	25-11-1997
			NZ	308879 A	25-11-1998
			RÜ	2133302 C1	20-07-1999
			WO	9637637 A1	28-11-1996
			US	5876584 A	02-03-1999
LIC E 474E07		12 12 1005		4120620 41	10.02.1002
US 5474587	Α	12-12-1995	DE	4130630 A1	18-03-1993
			AT	144759 T	15-11-1996
			CA	2119025 A1	01-04-1993
			MO	9306059 A1	01-04-1993
			DE	59207469 D1	05-12-1996
			DK	603259 T3	24-02-1997
•			EP	0603259 A1	29-06-1994
			ES	2096101 T3	01-03-1997
			FI	941180 A	11-03-1994
			GR	3022383 T3	30-04-1997
			JP	6510734 T	01-12-1994
			KR.	227970 B1	01-11-1999
			PT	100866 A ,B	31-01-1994
US 2002011683	A1	31-01-2002	AU	6491001 A	02-01-2002
			EP	1296889 A1	02-04-2003
			JP	2004501050 T	15-01-2004
•			WO	0198207 A1	27-12-2001
			TW	530034 B	01-05-2003
EP 0356800	Α	07-03-1990	DE	68901429 D1	11-06-1992
			EP	0356800 A1	07-03-1990
			JP	2149476 A	08-06-1990
			US	4952533 A	28-08-1990
			US	4902030 M	20 00 1990
US 4455385	 A	19-06-1984			
US 4455385	Α	19-06-1984	CA	1334677 C	07-03-1995
US 4455385	Α	19-06-1984	CA CH	1334677 C 623018 A5	07-03-1995 15-05-1981
US 4455385	Α	19-06-1984	CA CH DE	1334677 C 623018 A5 2627856 A1	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977
US 4455385	Α	19-06-1984	CA CH DE FR	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978
US 4455385	Α	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP JP JP JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP JP JP JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A 57040109 B	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977 25-08-1982
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A 57040109 B 7607252 A ,B,	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977 25-08-1982 03-01-1977
US 4455385	A	19-06-1984	CA CH DE FR GB IT JP JP JP JP JP JP	1334677 C 623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A 57040109 B	07-03-1995 15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977 25-08-1982

iformation on patent family members

International Application No FCT/FR2004/000929

Patent docume cited in search re		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 4562040	Α	31-12-1985	JP	1625360	С	18-11-1991
			ĴΡ	2051863	-	08-11-1990
			ĴΡ	60221365		06-11-1985
			ÄÜ	570788		24-03-1988
			AU	4122085		17-10-1985
			CA	1237876		14-06-1988
		•	DE	3571802		31-08-1989
			EP	0159186		23-10-1985
US 5196389	A	23-03-1993	 FR	2675713	A1	30-10-1992
			CA	2067268		30-10-1992
			DE	69223270		08-01-1998
			DĒ.	69223270		28-05-1998
			EP .	0511919		04-11-1992
			ËS	2111058		01-03-1998
			FΙ	921902		30-10-1992
			JР	5138043		01-06-1993
			· JP	7053240	B	07-06-1995
			KR	9600024	_	03-01-1996
US 4514346	A	30-04-1985	DE	3005587	A1	20-08-1981
	••	00 01 2300	AT	8774		15-08-1984
			CA	1157242		22-11-1983
			ĒΡ	0034328		26-08-1981
			ĴΡ		C	22-04-1987
			ĴΡ		Ā	09-10-1981
			JP	61041867	В	18-09-1986
US 6245424	B1	12-06-2001	US	5840221	Α	24-11-1998
			AU	722864		10-08-2000
			AU	5688498		29-06-1998
			BR	9714372		21-03-2000
			CA	2273100		11-06-1998
			CN	1239468		22-12-1999
			DE	69728060		15-04-2004
			ĒΡ	0946460		06-10-1999
			ĴΡ	3483035		06-01-2004
			JP		T	24-04-2001
			RU	2176628		10-12-2001
			TW	479074		11-03-2002
			MO .	9824737		11-06-1998
			ZA ·	9710215		03-06-1998
US 3205043	<u>-</u>	07-09-1965	NONE		· ····································	



			
A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE C04B35/573		
Selon la da	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	ation nationale et la CIB	
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
	tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles d	le classement)	
CIB 7	C04B		
Documental	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche
Base de doi	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n	nom de la base de données, et si réalisab	ole, termes de recherche utilisés)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPEN	DEX, CHEM ABS Data	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	<u> </u>	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication c	ies passages pertinents	no. des revendications visées
	. ,		
Α	US 5 560 809 A (CORTELLINI EDMUND 1 octobre 1996 (1996-10-01) revendication 1	A)	1–7
A	US 5 474 587 A (DIAS FRANCISCO J 12 décembre 1995 (1995-12-12) exemples	ET AL)	1
A	US 2002/011683 A1 (GADKAREE KISHOR AL) 31 janvier 2002 (2002-01-31) revendication 12; figure 1; exempl		1 .
A	EP 0 356 800 A (SHINETSU CHEMICAL 7 mars 1990 (1990-03-07) exemples	co)	1
		/	
	'		
		•	!
X Voir	la sulte du cadre C pour la fin de la liste des documents	χ Les documents de familles de bre	evets sont indiqués en annexe
° Catégorie:	s spéciales de documents cités:	document ultérieur publié après la date	e de dépôt international ou la
	ent définissant l'état général de la technique, non	date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cité pour co	as à l'état de la emprendre le principe
"E" docume	léré comme particulièrement pertinent ent antérieur, mais pubilé à la date de dépôt international	ou la théorie constituant la base de l' document particulièrement pertinent; f	invention
"L," docume	est cette date ent pouvant jeter un doute sur une revendication de	être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document co	comme impliquant une activité
priorite	é ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une reison spéciale (telle qu'indiquée)		inven tion revendiquée
"O" docum	ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à xposition ou tous autres moyens	lorsque le document est associé à un documents de même nature, cette co	ou plusieurs autres
P docume	ent publié avant la date de dépôt international, mais	pour une personne du métier l' document qui fait partie de la même fa	
<u> </u>	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport o	
7	septembre 2004	22/09/2004	
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 40-3016	Munro, B	٠

Depande Internationale No PCI/FR2004/000929

	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages p	pertinents no. des revendications visées
A	US 4 455 385 A (PROCHAZKA SVANTE) 19 juin 1984 (1984-06-19) colonne 2, ligne 25 - ligne 29; figure 2; exemples 3,10	1
A	US 4 562 040 A (YAMADA KOICHI ET AL) 31 décembre 1985 (1985-12-31) exemples	1
A	US 5 196 389 A (DUBOTS DOMINIQUE) 23 mars 1993 (1993-03-23) colonne 3, ligne 21 - colonne 4, ligne 16; exemple 3	1
A	US 4 514 346 A (DIAS FRANCISCO J ET AL) 30 avril 1985 (1985-04-30) exemple 1	1
A	US 6 245 424 B1 (LAU SAI-KWING ET AL) 12 juin 2001 (2001-06-12) colonne 2, ligne 31 - ligne 48	1
A	US 3 205 043 A (TAYLOR KENNETH M) 7 septembre 1965 (1965-09-07) figure 1; exemples	1
	DATABASE COMPENDEX 'Online! ENGINEERING INFORMATION, INC., NEW YORK, NY, US; HUANG QINGWEI ET AL: "Microstructure of reaction-bonded silicon carbide" XP002264185 Database accession no. E2000455311603 abrégé & HSI AN CHIAO TUNG TA HSUEH;HSI-AN CHIAO TUNG TA HSUEH/JOURNAL OF XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY FEB 2000, vol. 34, no. 2, février 2000 (2000-02), pages 89-91, 99,	

Renselgnements relati c membres de familles de brevets

Descande Internationale No PCI /FR2004/000929

					004/000929
Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5560809	Α	01-10-1996	AT	178105 T	15-04-1999
			ΑU	698926 B2	12-11-1998
			ΑU	5874096 A	11-12-1996
			BR	9608828 A	15-06-1999
			CA	2219890 A1	28-11-1996
			CN	1185815 A ,B	24-06-1998
	_		DE	69601870 D1	29-04-1999
			ĎΕ	69601870 T2	26-08-1999
			ĒΡ	0828866 A1	18-03-1998
			NO	975404 A	25-11-1997
			NZ	308879 A	25-11-1998
			RU	2133302 C1	20-07-1999
			WO	9637637 A1	28-11-1996
	•		ÜS	5876584 A	02-03-1999
US 5474587	Α	12-12-1995	DE		
00 07/ 7 00/	л	16 16-1330	AT	4130630 A1 144759 T	18-03-1993 15-11-1996
			CA	2119025 A1	15-11-1996 01-04-1993
			WO		
			DE	9306059 A1 59207469 D1	01-04-1993
			DK		05-12-1996
			EP	603259 T3	24-02-1997
	÷		ES	0603259 A1	29-06-1994
			FI	2096101 T3	01-03-1997
			GR	941180 A 3022383 T3	11-03-1994
•			JP	3022383 T3 6510734 T	30-04-1997
			KR	6510/34 I 227970 B1	01-12-1994
			PT	100866 A ,B	01-11-1999 31-01-1994
IIC 2002011600	A 1	21 01 0000			
US 2002011683	A1	31-01-2002	AU	6491001 A	02-01-2002
			EP	1296889 A1	02-04-2003
			JP	2004501050 T	15-01-2004
•			WO TW	0198207 A1 530034 B	27-12-2001
ED corcoss					01-05-2003
EP 0356800	Α	07-03-1990	DE	68901429 D1	11-06-1992
_			EP	0356800 A1	07-03-1990
•			JP	2149476 A	08-06-1990
			US	4952533 A	28-08-1990
US 4455385					
UU 770000	Α	19-06-1984	CA	1334677 C	07-03-1995
UU 440000	Α	19-06-1984	CH	1334677 C 623018 A5	07-03-1995 15-05-1981
00 4400000	A	19-06-1984	CH De	623018 A5 2627856 A1	
00 110000	Α	19-06-1984	CH De Fr	623018 A5	15-05-1981
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB	623018 A5 2627856 A1	15-05-1981 20-01-1977
03 4433365	Α	19-06-1984	CH DE FR GB IT	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977
03 4433365	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP JP JP JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A 57040109 B	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977 25-08-1982
03 4433363	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP JP JP JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A 57040109 B 7607252 A ,B,	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977 25-08-1982 03-01-1977
03 4433363	A	19-06-1984	CH DE FR GB IT JP JP JP JP JP JP JP	623018 A5 2627856 A1 2316028 A1 1533675 A 1063441 B 1512557 C 57170876 A 63063513 B 1512558 C 57170877 A 63063514 B 1167004 C 52006716 A 57040109 B	15-05-1981 20-01-1977 28-01-1977 29-11-1978 11-02-1985 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 09-08-1989 21-10-1982 07-12-1988 08-09-1983 19-01-1977 25-08-1982

Renseignements relai x membres de familles de brevets



Document brevet cité lu rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
					L
US 4562040	Α	31-12-1985	JP	1625360 C	18-11-1991
			JP	2051863 B	08-11-1990
			JP	60221365 A	06-11-1985
			AU	570788 B2	24-03-1988
			ΑU	4122085 A	17-10-1985
			CA	1237876 A1	14-06-1988
			DΕ	3571802 D1	31-08-1989
			EP	0159186 A2	23-10-1985
US 5196389	Α	23-03-1993	FR	2675713 A1	30-10-1992
			CA	2067268 A1	30-10-1992
			DE	69223270 D1	08-01-1998
			DE	69223270 T2	28-05-1998
			EP	0511919 A1	04-11-1992
			ES	2111058 T3	01-03-1998
			FI	921902 A	30-10-1992
			JP	5138043 A	01-06-1993
			JP		07-06-1995
				7053240 B	
			KR 	9600024 B1	03-01-1996
US 4514346	Α	30-04-1985	DE	3005587 A1	20-08-1981
•		,	ΑT	8774 T	15-08-1984
		,	CA	1157242 A1	22-11-1983
			EP	0034328 A1	26-08-1981
			JP	1376188 C	22-04-1987
			JP	56129665 A	09-10-1981
			JP	61041867 B	18-09-1986
US 6245424	B1	12-06-2001	US	5840221 A	24-11-1998
		_	AU	722864 B2	10-08-2000
•			AU	5688498 A	29-06-1998
			BR	9714372 A	21-03-2000
			CA	2273100 A1	11-06-1998
			CN	1239468 A	22-12-1999
			DE	69728060 D1	15-04-2004
		•	EP	0946460 A1	06-10-1999
			JP	3483035 B2	06-01-2004
			JP		
				2001505522 T	24-04-2001
			RU	2176628 C2	10-12-2001
			TW	479074 B	11-03-2002
		•	WO ZA	9824737 A1 9710215 A	11-06-1998 03-06-1998
US 3205043	Α	07-09-1965	AUCL	IN	